


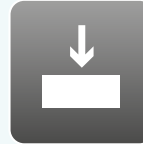
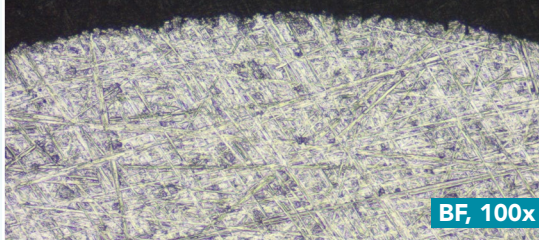


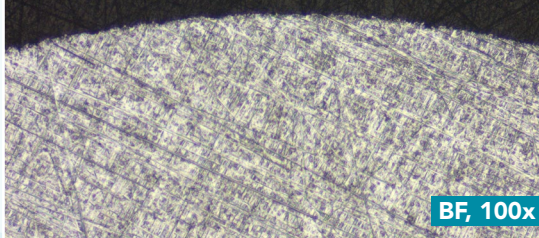

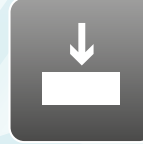

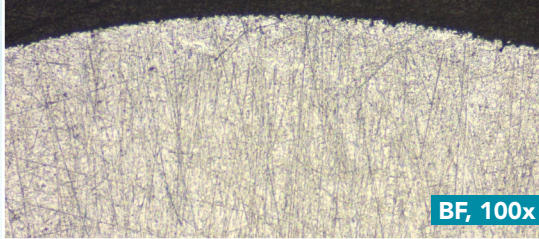




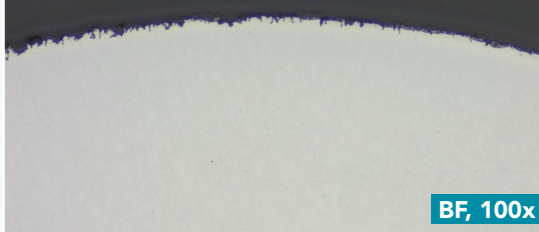


Aka-Brief #3 纯钛

1	 Piatto 220+	 水	 300 RPM	 20 N	 磨平	 BF, 100x
2	 Piatto 600+	 水	 300 RPM	 20 N	 2 min	 BF, 100x
3	 Allegran 3	 DiaUltra 6 µm	 150 RPM	 30 N + 20 N	 2 min + 2 min	 BF, 100x
4	 Chemal*	 Fumed Silica 0.2 µm Alkaline**	 150 RPM	 25 N + 15 N	 5 min + 5 min	 BF, 100x

图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

**96毫升 Fumed Silica,
2毫升 H₂O₂ (30%),
2毫升 NH₄OH (25%).

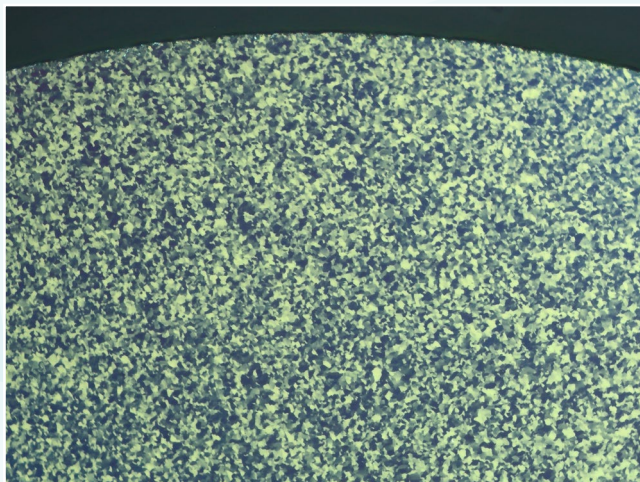
这种混合物应该在新鲜时使用（几个小时之内），并定期搅拌。

Aka-Brief #3 纯钛

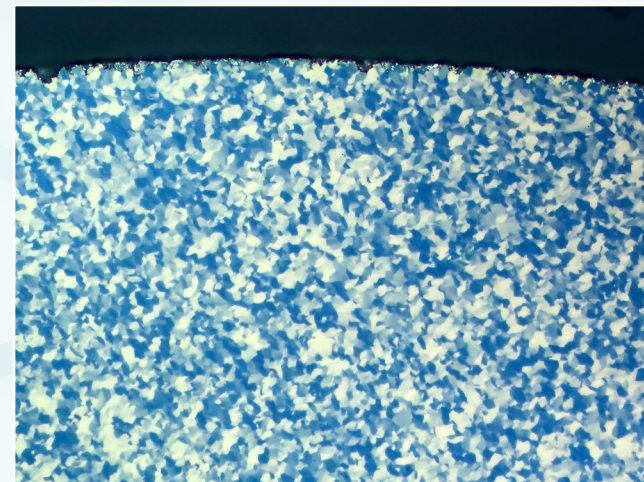
最终制样结果



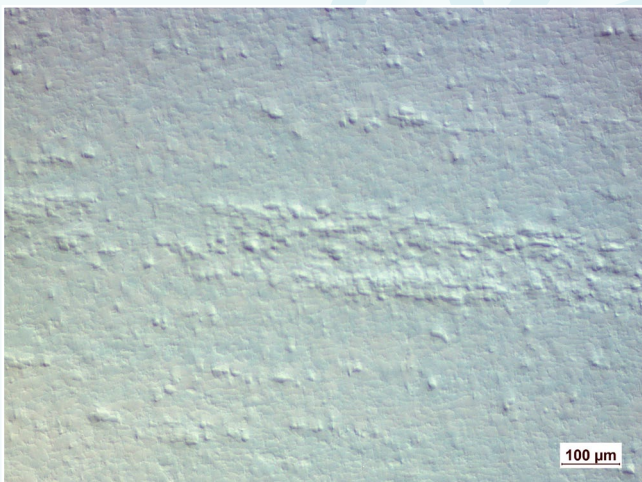
四级纯钛，微分干涉衬度像，100倍



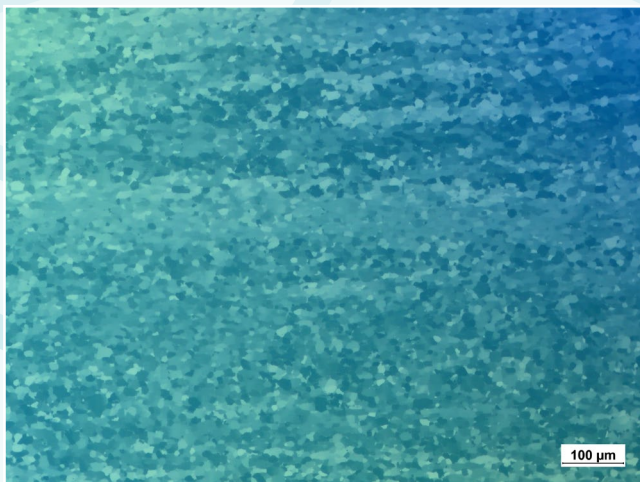
四级纯钛，偏正光+Lambda补偿片，100倍



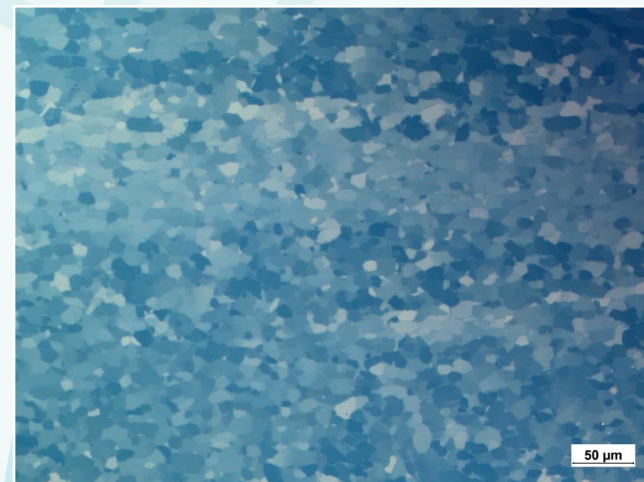
四级纯钛，偏正光+Lambda补偿片，200倍



二级纯钛，微分干涉衬度像，100倍



二级纯钛，偏正光+Lambda补偿片，100倍



二级纯钛，偏正光+Lambda补偿片，200倍